

**ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ «НОВЫХ ДОНОРОВ»
ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ КРЕМНИЯ
С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КИСЛОРОДА**

Б. А. Андреев, В. Г. Голубев, В. В. Емцев,
Г. И. Кропотов, Г. А. Оганесян, К. Шмальц

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021, Санкт-Петербург, Россия

(Поступила 22.09.1992. Принята к печати 28.09.1992)

Рассмотрены процессы образования «новых доноров» в кремнии с различным содержанием кислорода при $T = 600^\circ\text{C}$. Показано, что энергетический спектр новых доноров составной, и установлены его компоненты. При исследовании новых доноров выявлено, что термическая стабильность «классических» двойных термодоноров, образующихся при $T = 450^\circ\text{C}$, гораздо выше, чем принято считать в современной литературе. Процессы образования новых доноров сильно зависят от исходной концентрации кислорода.

Введение. Среди доминирующих электрически активных термодефектов, возникающих в кремнии, выращенном по методу Чохральского (Cz-Si) при $T = 350\text{--}700^\circ\text{C}$, практически всегда оказываются различные центры донорного типа. В свою очередь процессы образования термодоноров определяются как параметрами монокристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского (примесный состав, тепловой режим роста), так и параметрами самой термообработки (температура, длительность, атмосфера). В силу этих обстоятельств энергетический спектр и стабильность формирующихся термодоноров также чувствительны к указанным факторам.

В настоящее время наиболее подробно изучены свойства дискретных донорных состояний, образующихся в «чистом» Cz-Si при $T \gtrsim 500^\circ\text{C}$ (см., например, обзорные работы [1, 2]). С повышением температуры термообработки энергетический спектр термодоноров существенно изменяется, и при $T \gtrsim 600^\circ\text{C}$ возникающие донорные состояния уже характеризуются практически непрерывным энергетическим спектром в очень широком диапазоне — от $\approx E_c - 0.02$ до $\gtrsim E_c - 0.15$ эВ [3, 4], чем резко отличаются от «классических» термодоноров, формирующихся при $T \gtrsim 500^\circ\text{C}$. Это различие было закреплено в литературе введением обозначения «новые доноры», тем более что они оказались стабильными при $T \gtrsim 600^\circ\text{C}$, при которых классические термодоноры нестабильны. Последнее обстоятельство широко используется практически для отжига классических термодоноров при кратковременном нагреве образцов при $T = 600\text{--}650^\circ\text{C}$ в течение примерно одного часа (так называемый *donor killing annealing*). Согласно литературным данным, качественное различие свойств рассматриваемых термодоноров заключается в различной природе образующихся донорных состояний. Электрическая активность мелких скоплений атомов кислорода, возникающих при $T \gtrsim 500^\circ\text{C}$, обусловлена их сердцевиной, представляющей собой комплекс точечных дефектов (скорее всего двух атомов кислорода и межузельного атома кремния [5]). Напротив, появление донорных состояний в Cz-Si при $T \gtrsim 600^\circ\text{C}$ отражает

электрическую активность состояний на границе раздела преципитатов SiO_x (см., например, [4]); последние по аналогии с системой Si/SiO_2 , характеризуются наличием связанного положительного заряда вблизи границы раздела.

Однако проведенное недавно исследование температурных зависимостей концентрации электронов $n(T)$ для термообработанного Cz-Si с использованием гамма-облучения для последовательной компенсации термодоноров акцепторами радиационного происхождения [2, 6, 7] показало, что в действительности энергетический спектр новых доноров составной и соотношение компонентов в спектре очень сильно зависит от концентрации кислорода в исходном материале. При концентрации кислорода $N_{\text{oxy}} \approx 6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ образование крупных преципитатов при комбинированной термообработке вблизи $T \approx 1000^\circ\text{C}$ подавлено [8]. При большей концентрации кислорода его кластерирование при этих температурах ведет к появлению двух семейств донорных центров, которые по своим параметрам неожиданно оказались весьма близкими к термодонорам, характерным для более низкотемпературной термообработки $T \gtrsim 500^\circ\text{C}$ [2, 7].

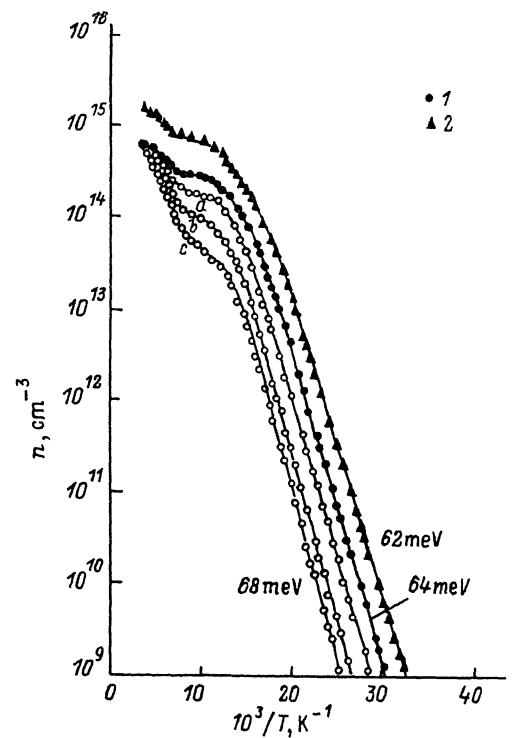
Экспериментальные данные, полученные в настоящей работе с помощью электрических и оптических измерений, позволяют уверенно идентифицировать вклад этих семейств донорных состояний в энергетический спектр новых доноров, устанавливая тем самым очень важную связь между термодонорами во всем температурном интервале $350^\circ \gtrsim T \gtrsim 700^\circ\text{C}$. Некоторые предварительные результаты, относящиеся к одному семейству двойных термодоноров, были приведены нами в [9].

1. Экспериментальные результаты

Образцы вырезались из высокоомного кремния p -типа с остаточной концентрацией примесей III и V групп, $N_a, N_d \gtrsim 5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$. По данным ИК спектроскопии, содержание кислорода составляло $\sim 8 \cdot 10^{17}$ и $\sim 6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ соответственно для образцов серий SK и TE . Концентрация углерода не превышала $5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Образцы подвергались термообработке в атмосфере сухого азота при 600°C в течение $t = 18\text{--}120$ ч. Для сравнительного изучения несколько контрольных образцов серии SK были термообработаны при $T = 450^\circ\text{C}$ в течение $t = 1\text{--}240$ ч. ИК спектры фотопроводимости при низких температурах $T = 4\text{--}30$ К регистрировались бесконтактным методом [10] в диапазоне $200\text{--}800 \text{ см}^{-1}$ на фурье-спектрометре IFS-113V «Vsgiker». В некоторых случаях оптические измерения проводились по методу пропускания. Измерение температурных зависимостей концентрации электронов проводимости $n(T)$ осуществлялось в диапазоне $T = 20\text{--}300$ К, и компьютерный анализ полученных кривых $n(T)$ проводился на основе соответствующих уравнений электронейтральности (см., например, [6, 11]). Для того чтобы расширить возможности такого анализа, мы использовали, как и в [6, 11], последовательную компенсацию донорных состояний акцепторными уровнями радиационного происхождения. С этой целью термообработанные образцы подвергались гамма-облучению ^{60}Co при комнатной температуре (мощность дозы облучения составляла $2.6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$). По данным емкостной спектроскопии, в наших условиях доля A -центров (с акцепторными уровнями $\approx E_c - 0.18$ эВ) в компенсации составляла около 95%. Каждая доза гамма-облучения позволяет ввести в рассмотрение новое уравнение электронейтральности с одной переменной величиной (концентрация A -центров), и, таким образом, набор доз облучения приводит к системе уравнений электронейтральности, анализ которой дает возможность выделить вклад различных компонентов в состав новых доноров (для классических доноров такая процедура рассмотрена в [11]).

Изменяя содержание кислорода и режимы термообработки, нам удалось выявить некоторые составляющие энергетического спектра новых доноров.

Рис. 1. Температурная зависимость концентрации электронов для образцов кремния серии TE после термообработки при $T = 600^{\circ}\text{C}$ в течение 50 ч (1) и 120 ч (2). $N_{\text{oxy}} = 6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Точки — эксперимент, кривые — расчет с учетом относительного распределения двойных термодоноров по энергии ионизации (по данным оптических измерений и результатам анализа уравнений электронейтральности для облученных образцов). В качестве иллюстрации приведены $n(T)$ для образца 1 после гамма-облучения. Доза $\Phi \cdot 10^{-17} \text{ см}^{-2}$: 1 — 0, a — 2.6; b — 4.1; c — 6.8. На рисунке указаны также эффективные энергии ионизации донорных состояний.



Кремний с концентрацией кислорода $N_{\text{ oxy}} = 6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. На рис. 1 приведена температурная зависимость $n(T)$ для двух образцов серии TE , подвергнутых термообработке при $T = 600^{\circ}\text{C}$. На кривых $n(T)$ отчетливо видны два участка ионизации термодоноров с энергией мелких и глубоких состояний соответственно ≈ 0.06 и ≈ 0.15 эВ. Никаких других (кроме остаточной примеси фосфора, обнаруживаемой в спектрах фотопроводимости) донорных центров в заметной концентрации не обнаружено. Последовательная компенсация донорных состояний акцепторами радиационного происхождения при гамма-облучении термообработанных образцов свидетельствует о том, что наблюдаемые термодоноры характеризуются распределением мелких состояний по энергии ионизации в интервале 62—68 мэВ. Анализ зависимостей $n(T)$ указывает на равенство полной концентрации мелких и глубоких донорных состояний. Приведенные факты позволили косвенно идентифицировать эти термодоноры как двойные донорные центры с параметрами, весьма близкими к классическим двойным донорам TDD , образующимся при $T \gtrsim 500^{\circ}\text{C}$; параметры последних см., например, в [1]. Заключение об идентичности делается с помощью спектроскопических методов исследования термодоноров.

На рис. 2, а изображен спектр фотопроводимости образца серии TE , подвергнутого термообработке при $T = 600^{\circ}\text{C}$ в течение 120 ч. При $T = 7\text{ K}$ в области частот от ~ 340 до $\sim 500 \text{ см}^{-1}$ наблюдается бесструктурная фотопроводимость, обусловленная прямой фотоионизацией примесных атомов фосфора в зону проводимости. Максимум кривой при $\nu = 365 \text{ см}^{-1}$ хорошо соответствует энергии ионизации этих донорных центров $E(P) = 45.59$ мэВ. В области частот 350 — 550 см^{-1} имеется много спектральных линий, выглядящих как линии поглощения на фоне континуума ионизации фосфора (см., например, [12, 13]). Идентификация спектральных линий может быть проведена на основе данных [1, 13]. Анализ показал наличие по крайней мере шести водородоподобных серий электронных переходов из основных состояний в p -состояния для новых термодоноров, которые идентичны спектру нейтральных двойных термодоноров $(TDD1)^0$ — $(TDD6)^0$ по классификации [1]. Это также наглядно представлено на рис. 3, на котором проведено сравнение фрагментов спектров двух образцов, подвергнутых нами термообработке при 450 и 600°C . При увеличении температуры образцов до 12 — 30 K линии поглощения TDD , показанные на рис. 2, 3, превращаются в линии фототермической ионизации [13].

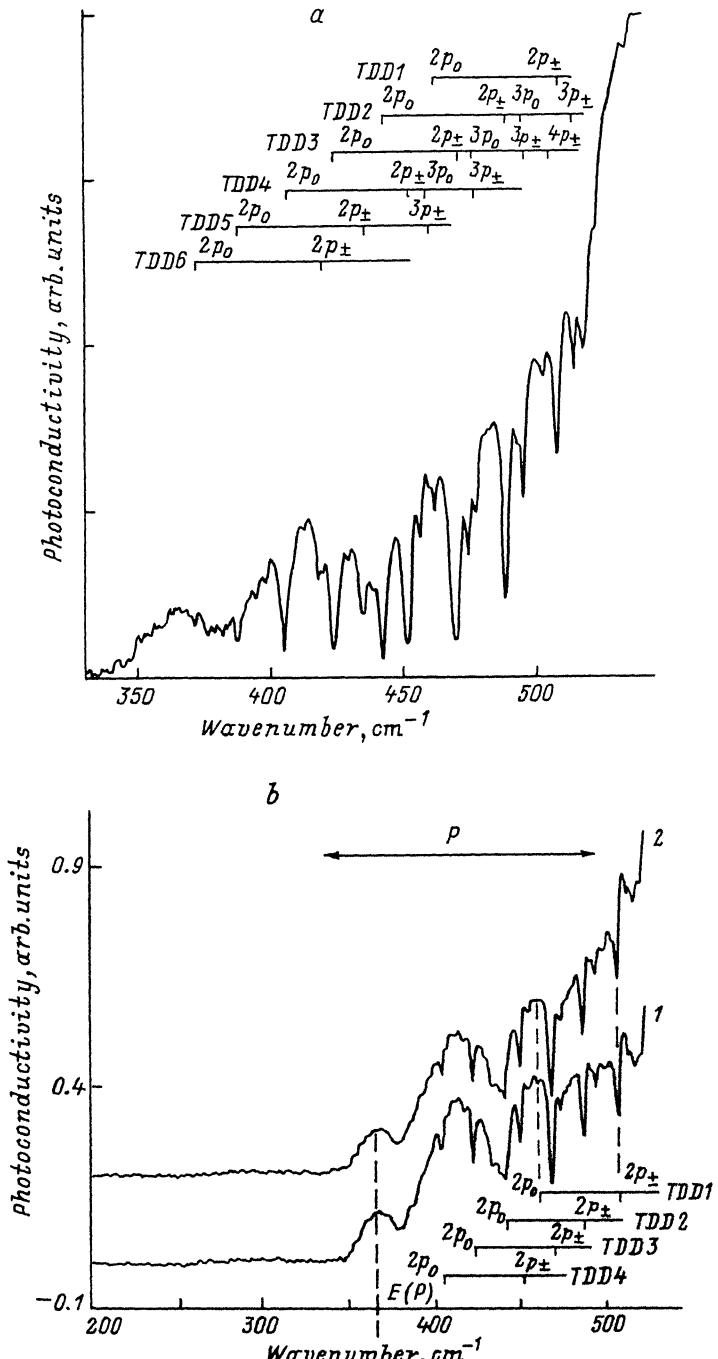


Рис. 2. Спектры фотопроводимости образца кремния серии TE после термообработки при $T = 600^\circ\text{C}$ в течение 120 ч. *a*) идентификация термодоноров (TDD)⁰. Спектр снят при $T = 7\text{ K}$ с разрешением 1 cm^{-1} , образец охлаждался в условиях межзонной подсветки. $N_{\text{oxy}} = 6 \cdot 10^{17}\text{ см}^{-3}$; *b*) бистабильность термодоноров TDD . Спектры сняты при $T = 6.4\text{ K}$ с разрешением 1 cm^{-1} и нормированы на интенсивность линии $2p_{\pm}$ (469 cm^{-1}) для (TDD_3)⁰; образец охлаждался при межзонной подсветке (1) и в темноте (2). Масштаб по оси ординат указан для спектра 1, спектр 2 сдвинут для наглядности. На данном рисунке, а также на рис. 7, 8 горизонтальными стрелками отмечены области фотоионизации указанных примесей.

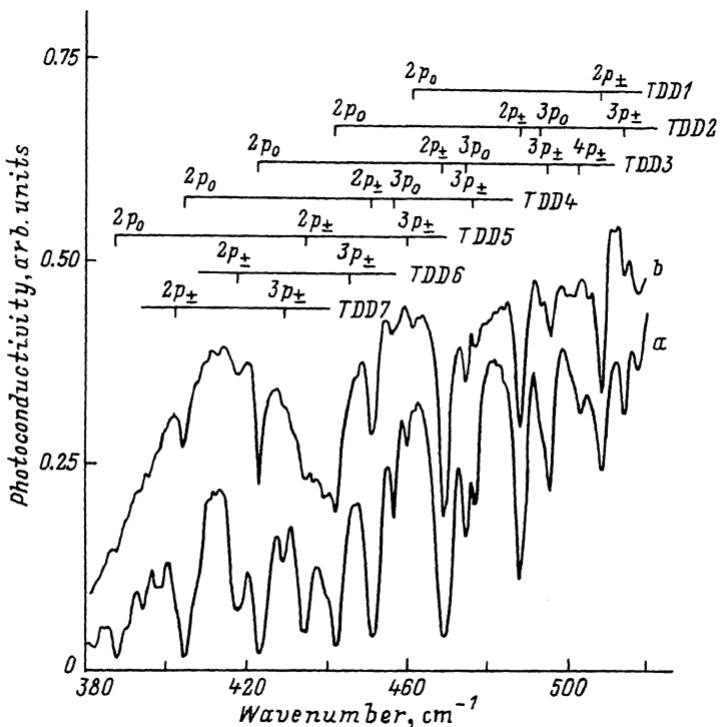


Рис. 3. Фрагменты спектров фотопроводимости образца кремния серии *SK* после термообработки при $T = 450$ °C в течение 16 ч (a) и образца серии *TE* после термообработки при $T = 600$ °C в течение 120 ч (b). $N_{\text{oxy}} = 8 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$ (a) и $6 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$ (b).

Спектры сняты при $T = 7.5$ (a) и 6.5 K (b) с разрешением 1 см $^{-1}$. Масштаб по оси ординат указан для спектра a, спектр b сдвинут для наглядности.

На рис. 4 изображен спектр поглощения образца серии *TE* после термообработки при 600 °C в течение 120 ч. В спектре, кроме хорошо известных линий поглощения, обусловленных локальными колебательными модами $^{16}\text{O}_1$ и $^{18}\text{O}_1$, имеются две серии линий электронных переходов из основного состояния в *p*-состояния для термодоноров, идентифицируемых как однократно положительно заряженные *TDD2* и *TDD3*, согласно классификации [1] (см. также [14]). Другие *TDD*, регистрируемые в спектрах фотопроводимости (рис. 2, 3), не удалось наблюдать методом пропускания из-за недостаточной чувствительности измерительной схемы. Это обстоятельство указывает на то, что донорные центры *TDD2* и *TDD3* являются доминирующими в распределении термодоноров по энергии ионизации (см. также далее). Полная концентрация *TDD* составляет $\approx 2 \cdot 10^{14}$ и $\approx 7 \cdot 10^{14}$ см $^{-3}$ после термообработки при 600 °C в течение 50 и 120 ч соответственно (рис. 1).

После того как идентичность двойных термодоноров, образующихся при $T \approx 500$ и $T = 600$ °C, была установлена, мы проверили, являются ли центры *TDD1* и *TDD2*, возникающие при 600 °C, по-прежнему бистабильными. Испытание проводилось по той же методике, как это делалось для указанных центров после термообработки Cz-Si при 450 °C (см., например, [1, 15]). Спектр фотопроводимости каждого образца серии *TE* записывался дважды — после охлаждения образца от комнатной температуры до $T = 4.2$ K в темноте и после такого же охлаждения в условиях межзонной подсветки от лампы накаливания (рис. 2, b). После термообработки при 600 °C интенсивность линий фотовозбуждения

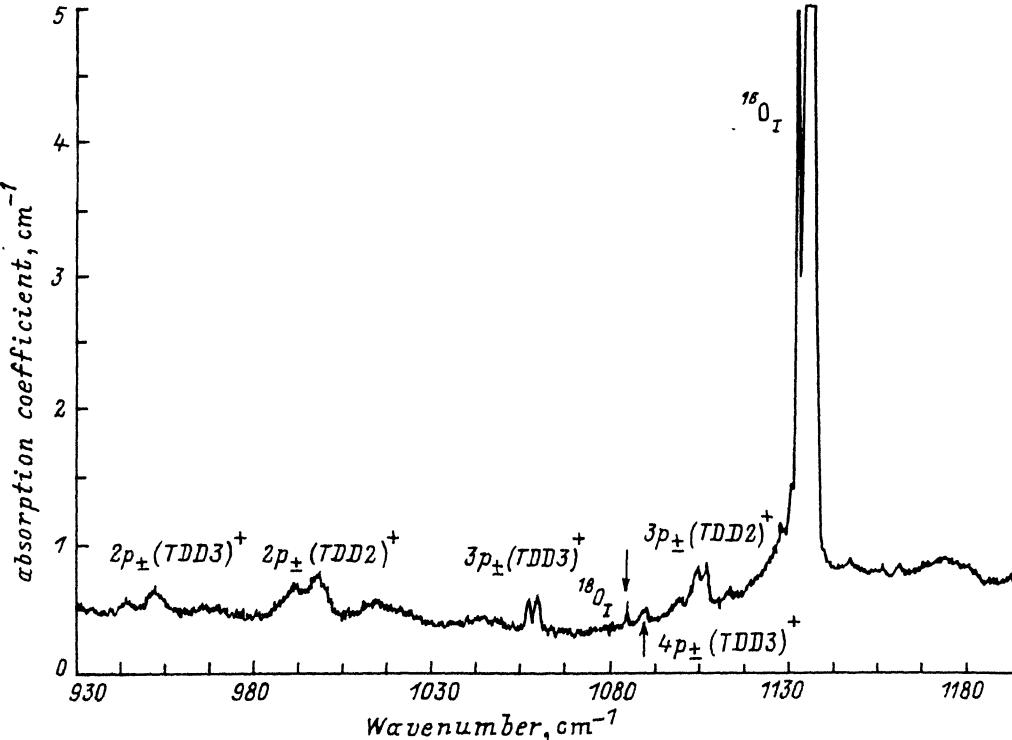


Рис. 4. Спектр поглощения образца кремния серии *TE* после термообработки при $T = 600$ $^{\circ}\text{C}$ в течение 120 ч. $N_{\text{oxy}} = 6 \cdot 10^{17}$ см^{-3} . Спектр снят при $T = 6.0$ К с разрешением 0.35 см^{-1} ; приемник излучения — HgCdTe . Образец облучен гамма-лучами для полной компенсации мелких донорных состояний: $(\text{TDD})^0 \rightarrow (\text{TDD})^+$.

TDD3—TDD6 не зависит от условий охлаждения образцов, как это имеет место и для классических *TDD*. Интенсивность линий фотовозбуждения *TDD1* увеличивалась после охлаждения образцов с подсветкой, и, следовательно, эти центры сохранили бистабильность атомной конфигурации. В то же время интенсивность линий фотовозбуждения *TDD2* не зависит от условий охлаждения образцов при любой длительности термообработки при 600 $^{\circ}\text{C}$ в интервале 50—120 ч. Таким образом, можно заключить, что центры *TDD2* утратили способность переходить из одной атомной конфигурации в другую. Мы полагаем, что это конфигурационное замораживание связано с наличием значительных внутренних упругих напряжений в *Cz-Si* при появлении мелких преципитатов (невидимых в электронный микроскоп [8]), скорость образования которых сильно возрастает при повышении температуры термообработки с 450 до 600 $^{\circ}\text{C}$.

Другое отличие термообработки *Cz-Si* с $N_{\text{oxy}} = 6 \cdot 10^{17}$ см^{-3} при более высокой температуре состоит в сильном изменении кинетики образования *TDD*. Во-первых, имеется скрытый период формирования термодоноров при 600 $^{\circ}\text{C}$ около 25 ч; при 450 $^{\circ}\text{C}$ такой период практически отсутствует. Во-вторых, скорость формирования *TDD* (после скрытого периода) составляет примерно $6 \cdot 10^{12}$ $\text{см}^{-3} \cdot \text{ч}^{-1}$, что на порядок величины меньше, чем скорость их образования при 450 $^{\circ}\text{C}$. В-третьих, меняется характер распределения *TDD* по энергии ионизации. Если при температурах около 450 $^{\circ}\text{C}$ «центр тяжести» в распределении *TDD* заметно сдвигается в сторону *TDD* с большими номерами при увеличении длительности термообработки (от *TDD2—TDD3* до *TDD4—TDD6* при термообработке в течение

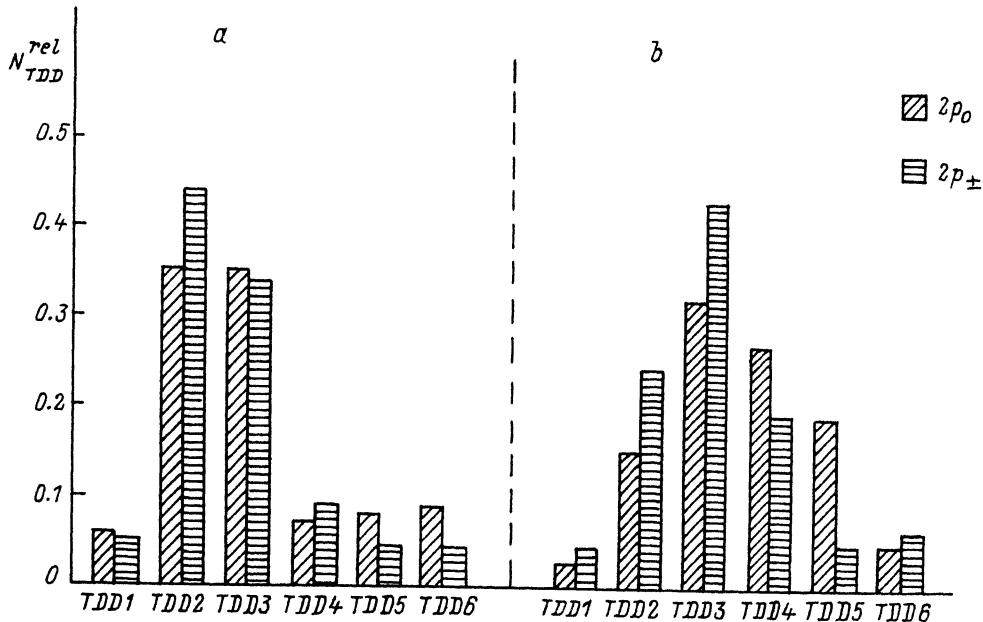
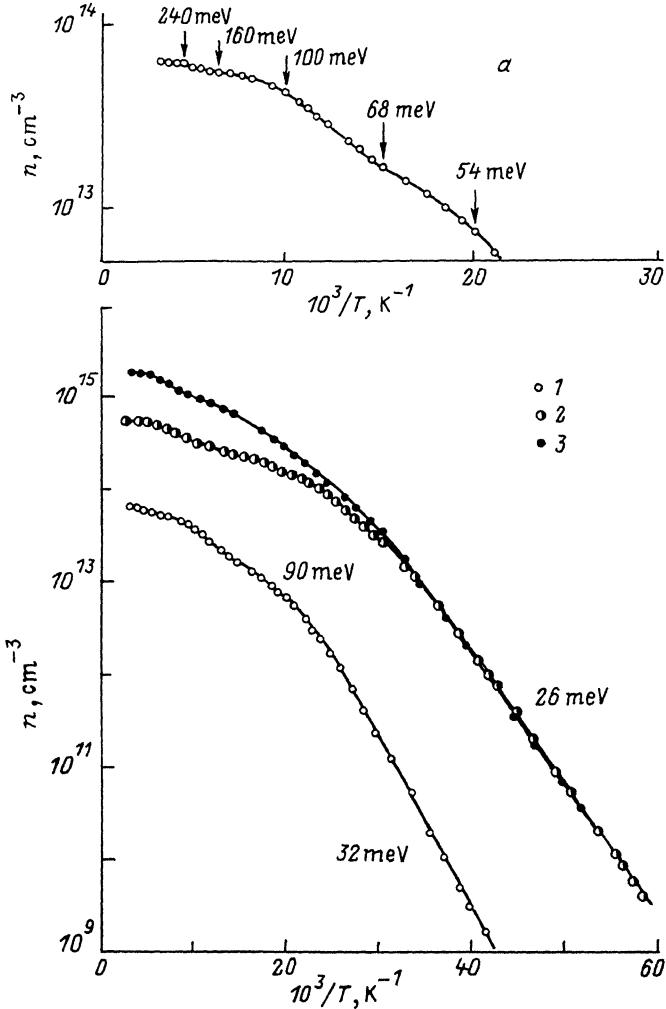


Рис. 5. Распределение двойных термодоноров TDD по энергии ионизации для образцов кремния серии TE после термообработки при $T = 600$ $^{\circ}\text{C}$ в течение 50 (а) и 120 ч (б). Интенсивности линий поглощения для переходов $1s \rightarrow 2p_0$ и $1s \rightarrow 2p_{\pm}$ определены из спектров, записанных при $T = 6.0$ К после охлаждения образцов в условиях межзонной подсветки. Интенсивности линий одного типа нормированы на полную интенсивность таких линий всех центров TDD . Различие в относительных концентрациях термодоноров, определенных по поглощению линий $2p_0$ и $2p_{\pm}$, несущественно для качественной оценки распределения TDD по энергии ионизации. $N_{\text{oxy}} = 6 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$.

нескольких часов и нескольких десятков часов соответственно; см., например, [$^{1, 16}$]), то при $T = 600$ $^{\circ}\text{C}$ распределение TDD мало изменяется при увеличении длительности термообработки — в нем доминируют термодоноры с небольшими номерами $TDD2-TDD3$ (рис. 5). Последнее обстоятельство подтверждается также результатами электрических измерений: как видно из рис. 1, в процессе термообработки при 600 $^{\circ}\text{C}$ эффективная энергия ионизации термодоноров, определяемая самыми мелкими донорными состояниями, меняется очень слабо, в то же самое время их полная концентрация возрастает в несколько раз.

Кремний с концентрацией кислорода $N_{\text{oxy}} = 8 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$. Положение качественно изменяется при термообработке образцов серии SK . После скрытого периода формирования термодоноров (существенно более короткого, чем для образцов серии TE , см. далее) в энергетическом спектре новых доноров уже наблюдается несколько донорных состояний (рис. 6): донорные состояния с энергией ионизации ≈ 0.03 и ≈ 0.09 эВ. Компьютерный анализ, кроме того, показывает наличие в сравнимой концентрации центров с энергией ионизации, близкой к TDD (≈ 0.07 и ≈ 0.15 эВ). В малой концентрации ($<< 10^{13}$ см $^{-3}$) мы обнаружили также глубокие состояния $\approx E_c - 0.2$ эВ. Последовательная компенсация мелких донорных состояний $\approx E_c - 0.03$ эВ акцепторами радиационного происхождения свидетельствует о том, что эти термодоноры характеризуются распределением по энергии ионизации в интервале 32—38 мэВ. По мере увеличения длительности термообработки указанный интервал расширяется в сторону более мелких донорных состояний (рис. 6). Анализ кривых $n(T)$ позволяет полагать, что донорные уровни $E_c - (0.03 \pm 0.04)$ и $\approx E_c - 0.09$ эВ принадлежат двойным донорным цен-



трам, так как их концентрации оказываются близкими (при расчетах определялся, кроме того, интервал возможных значений фактора вырождения мелких донорных состояний: $1/4 \lesssim \beta_{SD} \lesssim 1/2$). В таком случае их можно сопоставить с двойными донорными центрами, исследованными ранее в [17]. Авторы последней работы показали, что при длительной термообработке Cz-Si при $T \gtrsim 500^\circ\text{C}$ ($t \geq 100$ ч) концентрация термодоноров TDD начинает уменьшаться (после достижения максимума при $t \approx 100$ ч), и одновременно появляются другие термодоноры, которые были предположительно идентифицированы как новые двойные донорные центры с энергией ионизации ≈ 0.04 и ≈ 0.09 эВ (мы их будем в дальнейшем обозначать как $NTDD$). Максимальная концентрация рассматриваемых термодоноров составляет около 10^{15} cm^{-3} , и они оказались стабильными при $T \gtrsim 650^\circ\text{C}$ [17]. В наших контрольных экспериментах на образцах серии SK , термообработанных при 450°C в течение 60–240 ч, мы также наблюдали, как и в [17], появление таких термодоноров при $t \geq 60$ ч. Однако анализ температурных зависимостей n (T) показал, что кинетика их формирования при повышении температуры термообработки сильно изменяется и при $T = 600^\circ\text{C}$ на начальных этапах (до $t \approx 50$ ч) концентрация донорных состояний $NTDD$ в 2–3 раза выше,

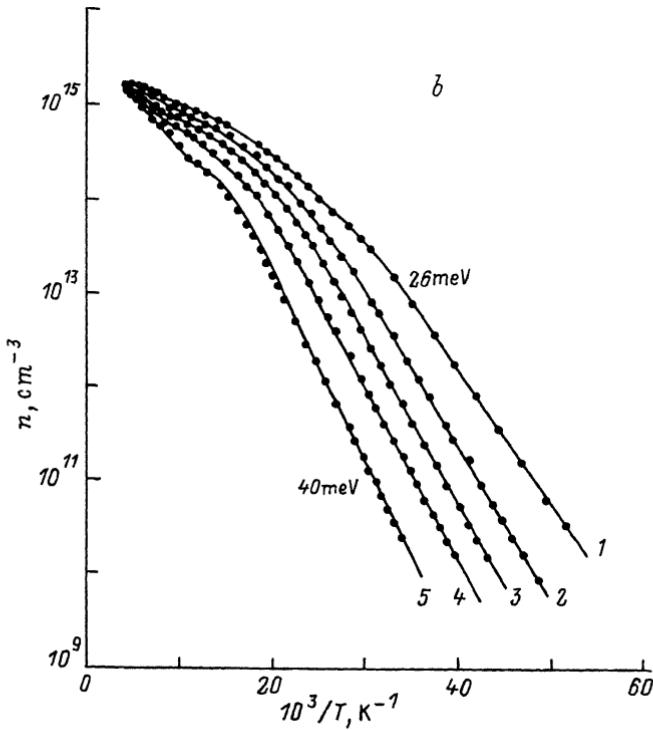


Рис. 6. Температурная зависимость концентрации электронов для образцов кремния серии SK после различной термообработки при $T = 600^\circ\text{C}$ (a), а также после термообработки при $T = 600^\circ\text{C}$ в течение 100 ч и последовательной компенсации мелких донорных состояний в процессе гамма-облучения (b). a) $N_{\text{oxy}} = 8 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Время термообработки, ч: 1 – 24, 2 – 50, 3 – 100. Точки – эксперимент, кривые – расчет с учетом центров NTDD и TDD. Отдельно показан фрагмент кривой 1 на растянутой шкале; стрелками указано положение уровня Ферми; b) точки – эксперимент, кривые – расчет с учетом донорных центров NTDD и TDD, а также компенсирующих A-центров. Доза гамма-облучения $\Phi \cdot 10^{-17} \text{ см}^{-2}$: 1 – 0, 2 – 3, 3 – 7, 4 – 13, 5 – 20. На рисунке указаны также эффективные энергии ионизации донорных состояний.

чем концентрация центров TDD. При дальнейшем увеличении длительности термообработки до $t \approx 100$ –120 ч образование центров NTDD существенно замедляется (или даже прекращается) и рост концентрации термодоноров идет в основном за счет образования центров TDD. Это хорошо видно из рис. 6: степень компенсации самых мелких донорных состояний практически одинакова (что возможно при практически одинаковой концентрации NTDD) для $t = 50$ и 100 ч, в то время как концентрация электронов проводимости заметно возрастает за счет более глубоких донорных центров, прежде всего TDD.

Перейдем теперь к обсуждению оптических данных для термообработанных образцов серии SK. На рис. 7 изображены спектры фотопроводимости одного из образцов серии SK в исходном состоянии (с дырочной проводимостью) и после термообработки при 600°C . До термообработки в спектре при $T = 16.5 \text{ K}$ наблюдаются линии фототермической ионизации бора – группа линий переходов серии $P_{3/2}$, среди которых наиболее интенсивная линия 4 (319.3 cm^{-1}). В области частот 600 – 700 cm^{-1} регистрируются линии переходов в состояния, связанные со спин-орбитально отщепленной валентной зоной $P_{1/2}$ – $2p'$ (668.89 cm^{-1}) и $3p'$ (693.03 cm^{-1}). Континuum фотоионизации бора находится в диапазоне энергий от ≈ 340 до 500 cm^{-1} с максимумом при 368 cm^{-1} , что соответствует энергии ионизации бора $E(\text{B}) = 45.71 \text{ мэВ}$. После термообработки, начиная с $t = 24$ ч,

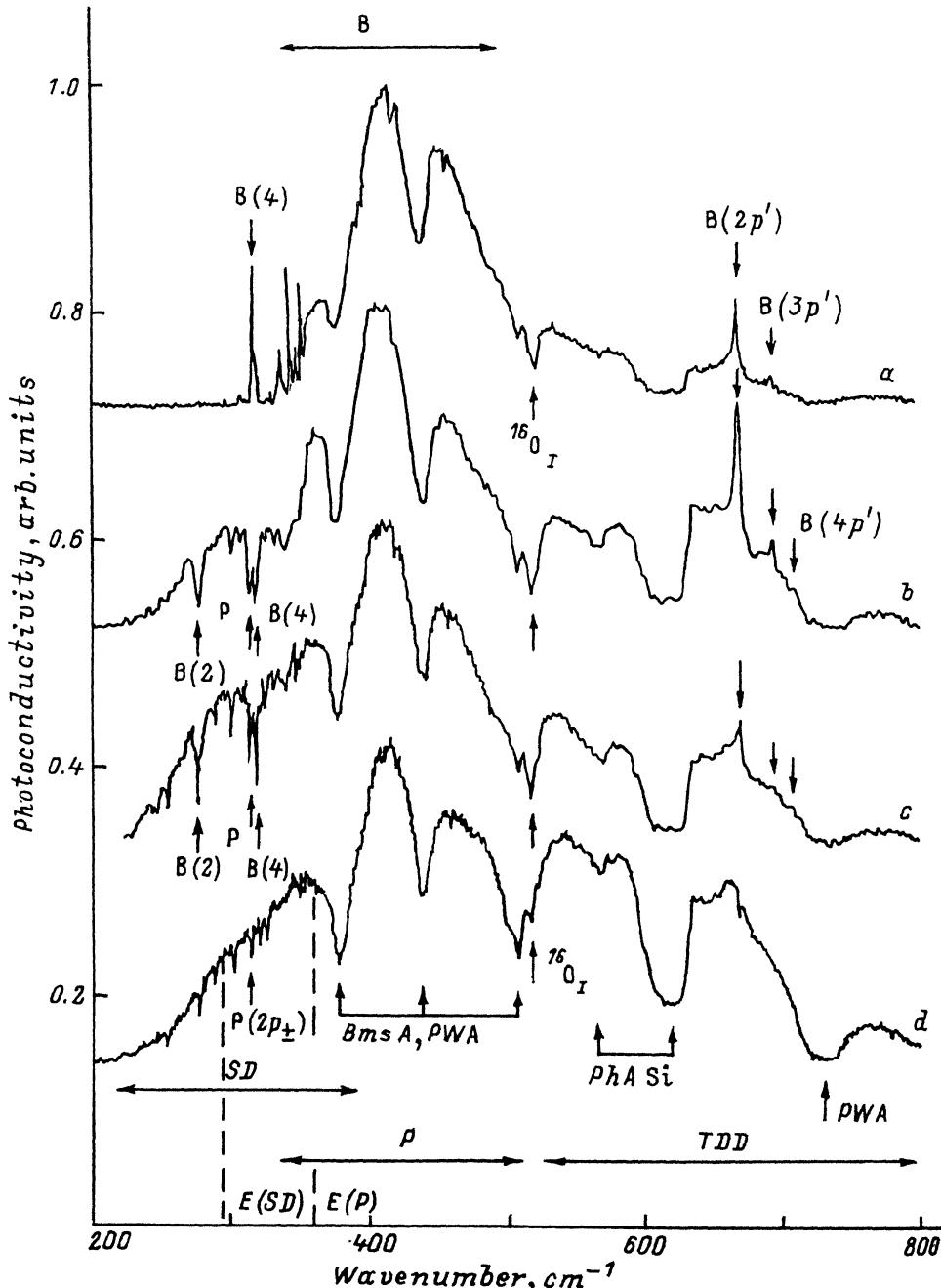


Рис. 7. Спектры фотопроводимости образцов кремния серии SK в исходном состоянии (a) и после термообработки при $T = 600^\circ\text{C}$ в течение 24 (b), 50 (c), 100 ч (d). $N_{\text{oxy}} = 8 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Спектры сняты при $T = 16.5$ (a), 6.4 (b), 6.3 К (c, d). Спектры b—d записаны при межзонной подсветке. Масштаб по оси ординат указан для спектра d, спектры a—c сдвинуты для наглядности. Спектры нормированы на максимум сигнала в континууме фотоионизации фосфора ($\sim 400 \text{ см}^{-1}$). B_{msA} — поглощение делителя луча, PWA — поглощение полиэтиленовых окон, P_{HSi} — фононное поглощение кремния.

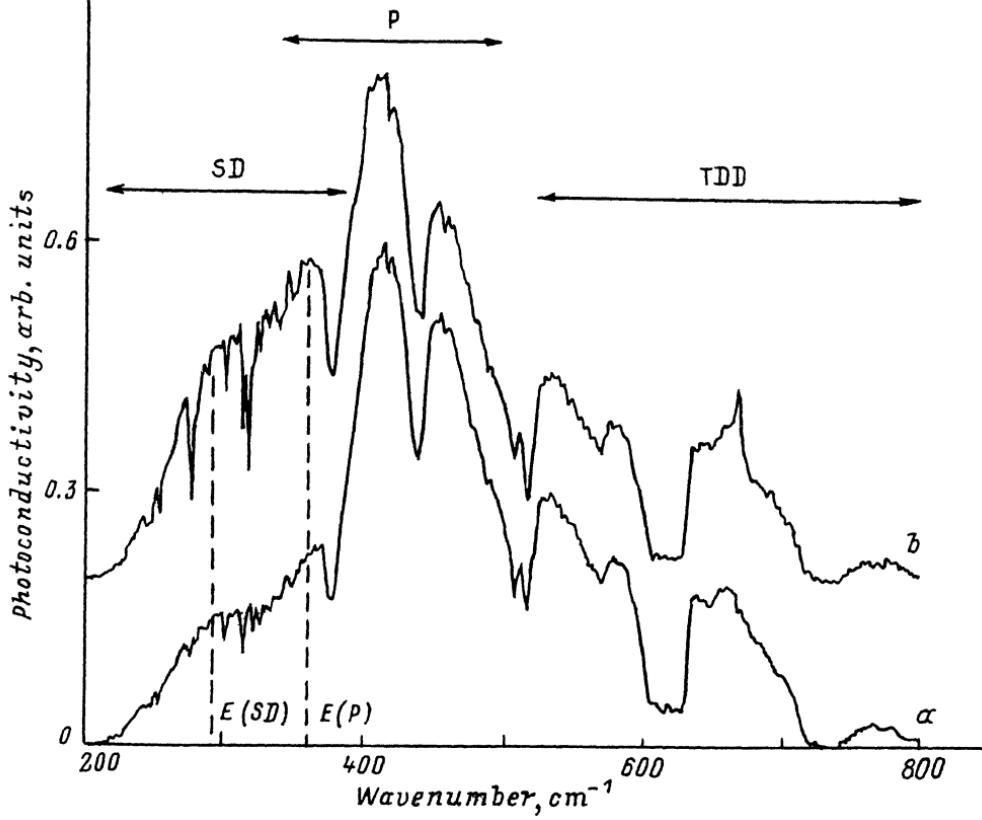


Рис. 8. Спектр фотопроводимости образца кремния серии *SK* после термообработки при $T = 600$ °С в течение 50 ч. $N_{\text{O}_x} = 8 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$. Спектры сняты при $T = 6.3$ К с разрешением 1 см $^{-1}$ без межзонной подсветки (*a*) и в условиях межзонной подсветки (*b*). Спектры нормированы на максимум сигнала в континууме фотоионизации фосфора (≈ 400 см $^{-1}$). Масштаб по оси ординат указан для спектра *a*, спектр *b* сдвинут для наглядности. Идентификацию линий см. на рис. 7.

образцы становятся *n*-типа проводимости, и в оптических экспериментах наблюдается линейчатый спектр фотовозбуждения примеси фосфора с наиболее интенсивной линией $2p_{\pm}$ (316.02 см $^{-1}$). Континуум фотоионизации фосфора находится в диапазоне энергий от ≈ 340 до ≈ 500 см $^{-1}$ с максимумом при ≈ 365 см $^{-1}$, как это отмечалось выше и для образцов серии *TE*. Линии фотовозбуждения бора наблюдаются лишь при межзонной подсветке. Заметим, что в термообработанных образцах линии фотовозбуждения фосфора наблюдаются при $T \leq 8$ К, когда фототермическая ионизация примесей в Si не эффективна (ср. с рис. 2, *a*). Это свидетельствует о наличии более мелких доноров в термообработанных образцах, на фоне континуума фотоионизации которых и регистрируются линии поглощения фосфора [12]. При увеличении температуры образца до 12–20 К линии поглощения фосфора превращаются в линии фототермической ионизации [13]. В диапазоне энергий ≈ 520 – 800 см $^{-1}$ регистрируется бесструктурная фотопроводимость, и спектр выглядит как континуум фотоионизации термодоноров *TDD* в нейтральном зарядовом состоянии. Ни при изменении температуры образца, ни при использовании межзонной подсветки не удалось наблюдать дискретные линии фотовозбуждения *TDD* 0 , как это имело место для образцов серии *TE* (рис. 2, 3). На начальных этапах термообработки ($t = 24$ – 50 ч) интенсивность континуума фотоионизации *TDD* 0 меньше, чем интенсивность

континуума фотоионизации фосфора и мелких донорных состояний, и сравнивается с последними при увеличении длительности термообработки до 100 ч (рис. 7, *b—d*), что свидетельствует о росте концентрации этих двойных термодоноров. Последнее согласуется с данными электрических измерений. В диапазоне энергии от ≈ 210 до 400 см^{-1} также наблюдается бесструктурная фотопроводимость с максимумом кривой фотоионизации при $\approx 295 \text{ см}^{-1}$, что соответствует $E(SD) = -36.6 \text{ мэВ}$, и спектр в этом диапазоне выглядит как континуум фотоионизации мелких однократных термодоноров, наблюдавшийся в Cz-Si после короткой термообработки (несколько часов) при 450°C [13]. По данным последней работы, это семейство термодоноров насчитывает семь типов центров STDA—STDG. Термодоноры STD могут быть образованы и при более высокой температуре, вплоть до 700°C [18—20], однако имеются основания не отождествлять мелкие донорные состояния E_c —($0.03 \div 0.04$) эВ в спектре новых доноров (рис. 6, 7) с центрами STD (см. далее). Под действием межзонной подсветки, нейтрализующей заряженные центры, интенсивность континуума мелких донорных состояний E_c —($0.03 \div 0.04$) эВ возрастает, тогда как в области $500 \div 800 \text{ см}^{-1}$ фотопроводимость практически не изменяется (рис. 8). Этот факт указывает на компенсацию донорных состояний, энергия ионизации которых в 1.5—2 раза меньше, чем у термодоноров TDD⁰.

Относительно кинетики образования рассматриваемых донорных состояний можно сделать следующие заключения. Во-первых, после короткой термообработки ($T = 600^\circ\text{C}$, $t = 18$ ч), когда образцы сохраняют еще дырочную проводимость, континуум фотоионизации в диапазоне частот от ≈ 210 до $\approx 400 \text{ см}^{-1}$ не наблюдается. Во-вторых, при увеличении длительности термообработки с 24 до 50 ч величина фотопроводимости в данном диапазоне возрастает, а затем немного уменьшается, что хорошо согласуется с результатами электрических измерений (см. выше).

Наконец, отметим общие моменты, которые выявились при сравнительном анализе спектров фотопроводимости термообработанных образцов серий TE и SK. Во-первых, термообработка образцов обеих серий при 600°C приводит к заметному уменьшению интенсивности линии поглощения на $\approx 517 \text{ см}^{-1}$, обусловленного локальной колебательной модой ν_1 межзельевых атомов кислорода $^{16}\text{O}_1$ (см. рис. 7). Во-вторых, метод фотоэлектрической спектроскопии позволил наблюдать сильное уменьшение интенсивности линий фотовозбуждения примеси бора (до почти полного исчезновения) при длительной термообработке ($t \geq 50$ ч). Напомним, что при такой длительности термообработки образцы обладают электронным типом проводимости, и линии фотовозбуждения компенсирующей примеси бора могут регистрироваться только в условиях межзонной подсветки. Примечательно, что при длительной термообработке ($t > 50$ ч) заметно уменьшается также интенсивность линий фотовозбуждения примеси фосфора.

2. Обсуждение экспериментальных результатов

Из приведенных данных следует, что при $N_{\text{oxy}} = 6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ на температурной границе формирования новых доноров ($T = 600^\circ\text{C}$) проявляется только один тип термодоноров, надежно идентифицированных в настоящей работе как двойные донорные центры TDD. Такие центры интенсивно возникают в Cz-Si при температурах около 450°C и, как считается в современной литературе, область их термической устойчивости ограничена $T \approx 550^\circ\text{C}$ (см., например, [1]). Однако наши данные заставляют пересмотреть интерпретацию процесса исчезновения термодоноров TDD в результате очень длительной термообработки Cz-Si при $T = 450^\circ\text{C}$ ($t > 100$ ч) [17] или при повышении температуры до $T \approx 600^\circ\text{C}$ как процесс их полного разрушения. В таком случае речь должна идти о структурном

преобразовании электрически активной «сердцевины» термодоноров, представляющих собой небольшие скопления атомов кислорода.

Даже при небольшом увеличении концентрации кислорода до $N_{\text{oxy}} = 8 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ процессы формирования новых доноров становятся более сложными: наряду с центрами TDD формируются термодоноры другого типа $NTDD$, причем начальная скорость их образования оказалась выше, чем для TDD . Это обстоятельство приводит к сокращению скрытого периода формирования новых доноров в таких материалах. У нас нет оснований отождествлять мелкие донорные состояния E_c — $(0.3 \div 0.4)$ эВ с однократными термодонорами STD , структура которых представлена примесными комплексами типа $[\text{NO}]$ [18–20]. Как уже отмечалось, мы не наблюдали образования мелких донорных центров типа STD в наших контрольных образцах, термообработанных при $T = 450^\circ\text{C}$ в интервале $t = 1\text{--}240$ ч. Поскольку термообработка при $T = 450$ и 600°C проводилась в атмосфере азота, мы провели контрольные эксперименты с целью усилить возможное влияние такой атмосферы на процесс формирования центров STD . Для этого образцы серии SK были подвергнуты комбинированной термообработке в атмосфере азота — предварительной в диапазоне $T = 700\text{--}1000^\circ\text{C}$ в течение 30 мин (без специальной закалки) и основной при $T = 450^\circ\text{C}$ в течение 1 ч. Ни в одном случае не было зарегистрировано появление термодоноров STD , несмотря на очень высокую чувствительность метода фототермоионизационной спектроскопии ($\gtrsim 10^9$ мелких примесных состояний в cm^{-3} [21]). Исходя из этого факта и принимая во внимание, что все образцы в настоящей работе были изготовлены из одного слитка $Cz\text{-Si}$, мы не считаем примесь азота ответственной за формирование мелких донорных состояний E_c — $(0.03 \div 0.04)$ эВ, которые проявляются в температурных зависимостях $n(T)$ для образцов серии SK после длительной термообработки при $T = 450^\circ\text{C}$ ($t > 60$ ч) и после термообработки при $T = 600^\circ\text{C}$ ($t > 24$ ч).

Отметим то обстоятельство, что после термообработки при $T = 600^\circ\text{C}$ в образцах серии SK не удалось наблюдать дискретных линий фотовозбуждения ни двойных термодоноров TDD^0 (в отличие от образцов серии TE), ни мелких донорных состояний E_c — $(0.03 \div 0.04)$ эВ. Концентрационный механизм, связанный с существенным перекрытием волновых функций мелких донорных состояний и приводящий к уширению спектральных линий, эффективен в кремнии лишь при концентрациях, больших 10^{16} см^{-3} [21]. Представляется более вероятным, что линии фотовозбуждения мелких донорных состояний в нашем случае сильно неоднородно уширены под действием случайных деформаций. На эту мысль наводит тот факт, что в образцах серии SK ширина спектральных линий бора и фосфора, зарегистрированных по поглощению (рис. 7, $a\text{--}d$), составляет соответственно $1.5 \div 2.4$ и $1.2 \div 1.7 \text{ cm}^{-1}$, что заметно превышает ширину линий в спектрах пропускания исходных образцов $\gtrsim 1.3$ и $\gtrsim 0.5 \text{ cm}^{-1}$ для примесей бора и фосфора соответственно. Оценим максимальную величину упругого напряжения, которое могло бы вызвать наблюдаемое уширение линий фосфора. Согласно [22], уширение на $\approx 1 \text{ cm}^{-1}$ линии перехода $1s(A_1) \rightarrow 2p_{\pm}$, имеющей ширину $\approx 0.5 \text{ cm}^{-1}$, достигается при приложении давления $\approx 10^7 \text{ дин}/\text{см}^2$. Теперь грубо оценим минимальную величину упругого напряжения, действующего на термодоноры TDD . Среднее расстояние между спектральными линиями фотовозбуждения нейтральных $TDD1\text{--}TDD6$ составляет примерно 4 cm^{-1} [1]. При средней ширине линий около 2 cm^{-1} для сдвига и перекрытия линий в спектре фотовозбуждения $(TDD)^0$ достаточно сдвига на $\approx 1 \text{ cm}^{-1}$, который достигается при приложении давления $\geq (2\text{--}4) \cdot 10^8 \text{ дин}/\text{см}^2$ [23]. Разница в давлении более чем на порядок величины для примерно одинакового уширения линий в спектре фосфора и термодоноров $(TDD)^0$, естественно, объясняется более низкой симметрией последних (C_{2v}) по сравнению с замещающей примесью фосфора (T_d). Таким образом, эти оценки свидетельствуют о том, что упругая деформация

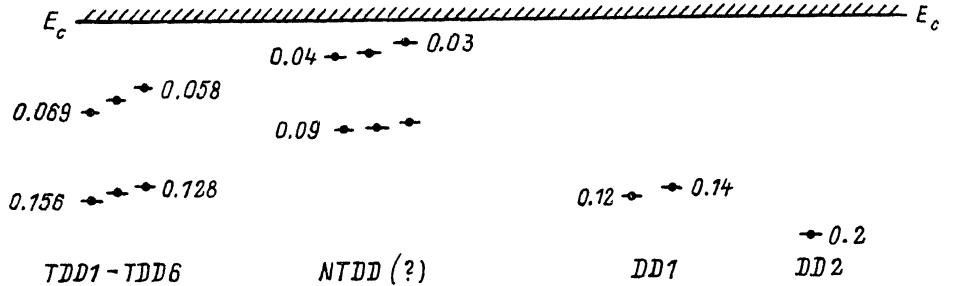


Рис. 9. Энергетический спектр новых доноров в термообработанном кремнии. Положение донорных уровней указано в эВ относительно зоны проводимости.

в термообработанных образцах серии *SK* распределена неравномерно, а именно термодоноры *TDD* и *NTDD* расположены в местах с существенно более высоким упругим напряжением, чем в среднем по объему кристалла (в отличие от примеси фосфора). Причиной такого неоднородного распределения новых доноров следует считать скорее всего исходную неоднородность распределения примеси кислорода на микроскопической шкале, которая усиливается в процессе термообработки при $T = 600$ °С. Действительно, длина диффузионного смещения атомов кислорода при указанной термообработке в течение $t \approx 4$ ч близка к среднему расстоянию между примесными атомами даже при содержании кислорода в кремнии $N_{\text{oxy}} \approx 6 \cdot 10^{17}$ см⁻³.

Наконец, коротко обсудим еще одно обстоятельство. Как известно, преципитация кислорода при термообработке *Cz-Si* приводит к уменьшению интенсивности оптического поглощения в полосах, связанных с колебательными модами изолированных межузельных атомов кислорода. Это отмечалось и в настоящей работе. Процесс преципитации сопровождается появлением собственных межузельных атомов *Si_i*, эмиттируемых из растущих преципитатов [24]. Такие собственные дефекты способны взаимодействовать с замещающими примесными атомами III группы по реакции Уоткинса, вызывая появление межузельных примесных атомов. Действительно, из радиационных экспериментов известно, что для примеси бора в кремнии возможна реакция $\text{Si}_i + \text{B}_s \rightarrow [\text{Si}_i\text{B}_s]$ с уходом межузельных примесных атомов при $T \geq 300$ К на какие-либо стоки в кристалле [25]. В результате рассматриваемой реакции концентрация примесных атомов в узлах кристаллической решетки уменьшается.

В работе [26] было показано, что сильное уменьшение концентрации замещающего бора происходит в *Cz-Si* ($N_B^{in} = 7 \cdot 10^{16}$ см⁻³, $N_{\text{oxy}}^{in} = 7.5 \cdot 10^{17}$ см⁻³) в процессе длительной термообработки при $T = 450$ °С ($t > 100$ ч). Сильное уменьшение концентрации замещающего бора было зарегистрировано и в настоящей работе с некоторыми отличиями: термообработка проводилась при $T = 600$ °С, $t \approx 100$ ч, и концентрация бора была существенно меньше ($\approx 5 \cdot 10^{13}$ см⁻³). Таким образом, следует полагать, что образование *Si_i* сопровождает процесс преципитации кислорода во всем диапазоне $T = 450$ –600 °С, и примесные атомы бора даже при малой их концентрации являются эффективными ловушками для *Si_i*. Что касается примесных атомов фосфора (в виде остаточной примеси в *Cz-Si*), то уменьшение интенсивности фотовозбуждения фосфора при преципитации кислорода указывает на его взаимодействие с точечными дефектами в процессе термообработки. Однако наиболее изученные в радиационных экспериментах *E*-центры (комплекс вакансия—замещающий атом фосфора) термически неустойчивы уже при $T \geq 150$ °С [27]. Другие «радиационные» дефекты, включающие в себя примесь фосфора и устойчивые до $T \approx 420$ °С [28], также не могут привлекаться к рассмотрению, учитывая температурный интервал

формирования новых доноров. Скорее всего здесь мы имеем дело со сложными комплексами дефектов, в образовании которых участвуют примесные атомы фосфора, собственные межузельные атомы и примесные атомы углерода.

Заключение. 1. Показано, что считающийся в литературе квазинепрерывным энергетический спектр новых доноров в действительности составной.

2. Установлены компоненты этого спектра (рис. 9). Надежно идентифицированы двойные донорные центры TDD с уровнями $\approx E_c - 0.07$ и $E_c - 0.15$ эВ. Донорные состояния $E_c - (0.03 \div 0.4)$ эВ и $\approx E_c - 0.09$ эВ отнесены нами к другим двойным центрам — $NTDD$. Оба типа центров TDD и $NTDD$ не являются специфическими для термообработки при $T = 600$ °C. Их образование наблюдается и при $T \geq 500$ °C, правда, с существенными отличиями в кинетике формирования. Действительно, новыми в энергетическом спектре новых доноров являются глубокие донорные состояния $\approx E_c - 0.1$ эВ ($DD1$) и $\geq E_c - 0.2$ эВ ($DD2$), доминирующие в $Cz\text{-Si}$ после термообработки при $T = 700$ °C [^{2, 7}].

3. В связи с тем, что термическая стабильность двойных термодоноров TDD оказалась гораздо выше, чем принято считать в современной литературе, необходимо пересмотреть принятые модельные представления о кинетике процессов их образования и разрушения [²⁹].

4. Показано, что особенности формирования центров TDD и $NTDD$ в $Cz\text{-Si}$ при $T = 600$ °C очень чувствительны к исходной концентрации кислорода. При концентрации кислорода $N_{O_{xy}} \approx 6 \cdot 10^{17}$ см⁻³ новые доноры представлены только центрами TDD . При $N_{O_{xy}} \geq 8 \cdot 10^{17}$ см⁻³ термообработка приводит к одновременному формированию центров $NTDD$ и TDD .

5. Точечные дефекты, появляющиеся вследствие преципитации кислорода в $Cz\text{-Si}$ при $T = 600$ °C, эффективно взаимодействуют даже с остаточными примесями бора и фосфора (в концентрации менее 10^{14} см⁻³), что приводит к потере электрической активности этих примесных состояний.

Авторы признательны профессору Б. Пажо (Парижский университет-7) за измерение и анализ спектров термодоноров (TDD)⁺.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] P. Wagner, J. Hage. Appl. Phys. A, A49, 123 (1989).
- [2] V. V. Emtev, Yu. N. Daluda, K. Schmalz. Sol. St. Phenomena, 19, 229 (1991).
- [3] B. M. Бабич, Н. П. Баран, Ю. П. Доценко и др. УФЖ, 33, 593 (1988).
- [4] G. Pensl, M. Schulz, K. Hölzlein, W. Bergholz, J. L. Hutchison. Appl. Phys. A, A48, 49 (1989).
- [5] P. Deak, L. C. Snyder, J. W. Corbett. Phys. Rev. Lett., 66, 747 (1991).
- [6] Yu. N. Daluda, V. V. Emtev, K. Schmalz. Rad. Eff., 107, 93 (1989).
- [7] V. V. Emtev, G. A. Oganesyan, K. Schmalz. Proc. I National Conf. on Def. in Semicond. St.-Petersburg (1992).
- [8] F. Shimura. Sol. St. Phenomena, 19, 1 (1991).
- [9] Б. А. Андреев, В. Г. Голубев, В. В. Емцев, Г. И. Кропотов, Г. А. Оганесян, К. Шмальц. Письма ЖЭТФ, 55, 52 (1992).
- [10] Б. А. Андреев, В. Б. Иконников, Г. А. Максимов, В. Б. Шмагин. Высокочистые вещества, 1, 138 (1987).
- [11] Ю. Н. Далуда, В. В. Емцев, П. Д. Кервалишвили, В. И. Петров, К. Шмальц. ФТП, 21, 1283 (1987).
- [12] G. Bambakidis, G. J. Brown. Phys. Rev. B, 33, 8180 (1986).
- [13] J. A. Griffin, J. Hartung, J. Weber, H. Navarro, L. Genzel. Appl. Phys. A, A48, 41 (1989).
- [14] B. Pajot, J. von Bardeleben. Proc. XIII Int. Conf. on Def. in Semicond. The Metallurgical Society of AIME. 685. Warrendale (1985).
- [15] Ya. N. Latushko, L. F. Makarenko, V. P. Markevich, L. I. Murin. Phys. St. Sol. (a), 93, K181 (1986).
- [16] P. Wagner. In: MRS Symposia Proc., Pittsburg, 59, 125 (1986).
- [17] Y. Kamiura, F. Hashimoto, M. Yoneta. Mater. Sci. Forum, 38, 673 (1989).
- [18] M. Suezawa, K. Sumino, H. Harada, T. Abe. Japan. J. Appl. Phys., 27, 62 (1988).
- [19] A. Hara, I. Hirai, A. Ohnawa. J. Appl. Phys., 67, 2462 (1990).
- [20] A. G. Steele, L. C. Lenchyshyn, M. L. W. Thewalt. Appl. Phys. Lett., 56, 148 (1990).
- [21] Sh. M. Kogan, T. M. Lifshits. Phys. St. Sol. (a), 39, 11 (1977).
- [22] A. K. Ramdas, S. Rodriguez. Rep. Progr. Phys., 44, 1297 (1987).

- [23] L. C. Kimerling, J. L. Benton, K. M. Lee, M. Stavola. In: MRS Symposia Proc., Pittsburg, **46**, 3 (1985).
- [24] A. Bourett. In: MRS Symposia Proc., Pittsburg, **59**, 223 (1986).
- [25] G. D. Watkins. Phys. Rev. B, **12**, 5824 (1975).
- [26] M. Claybourne, R. C. Newman. Mater. Sci. Forum, **38—41**, 613 (1989).
- [27] G. D. Watkins, J. W. Gorbett. Phys. Rev., **134**, 1359 (1964).
- [28] В. В. Емцев, Т. В. Машовец, А. Г. Абдусаттаров. ФТП, **21**, 2106 (1987).
- [29] W. Götz, G. Pensl, W. Zulehner. Phys. Rev., **46**, 4312 (1992).

Редактор В. В. Чалдышев
